PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

05-178989

(43) Date of publication of application: 20.07.1993

(51)Int.CI.

C08G 73/00 C09D179/00

(21)Application number: 03-360226

(71)Applicant: NITTO CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

27.12.1991

(72)Inventor: SHIMIZU SHIGERU

SAITO TAKASHI **NAKAMURA TOMIO**

(54) SULFONATED ANILINE COPOLYMER AND PRODUCTION THEREOF

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide the title copolymer which not only has high electric conductivity but also is soluble in water or an alcohol so that it has an improved coating performance. CONSTITUTION: At least one compound selected from the group consisting of aniline, N-alkylanilines and phenylenediamines is copolymerized with aminobenzenesulfonic acid to improve the solubility in a sulfonating solvent. Then, sulfonation is conducted to obtain a new title copolymer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

18.02.1998

[Date of sending the examiner's decision of

rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3051244

[Date of registration]

31.03.2000

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平5-178989

(43)公開日 平成5年(1993)7月20日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

C 0 8 G 73/00

NTB PLT 9285-4 J

C 0 9 D 179/00

8830-4 J

審査請求 未請求 請求項の数2(全 8 頁)

•			
(21)出願番号	特顯平3-360226	(71)出願人	000003953
			日東化学工業株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)12月27日		東京都千代田区丸の内1丁目5番1号
		(72)発明者	清水 茂
			神奈川県横浜市鶴見区大黒町10番1号 日
			東化学工業株式会社中央研究所内
		(72)発明者	▲斎▼藤 隆司
			神奈川県横浜市鶴見区大黒町10番 1号 日
	·		東化学工業株式会社中央研究所内
		(72)発明者	中村 富雄
			神奈川県横浜市鶴見区大黒町10番 1号 日
			東化学工業株式会社中央研究所内
		(74)代理人	弁理士 友松 英爾 (外1名)
		I	

(54)【発明の名称】 アニリン系共重合体スルホン化物とその製法

(57)【要約】

【目的】 高い導電性を発現させると共に、水およびアルコール可溶性であり、それにより塗布性を向上させたアニリン系共重合体スルホン化物を提供すること。

【構成】 アニリン、N-アルキルアニリン及びフェニレンジアミン類よりなる群から選ばれた少なくとも一種の化合物(A)とアミノベンゼンスルホン酸(B)とを共重合させ、これによりスルホン化溶媒に対する溶解性を向上させた後、スルホン化を行うことにより、新規なアニリン系共重合体スルホン化物を得る。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 アニリン、Nーアルキルアニリンおよびフェニレンジアミン類よりなる群から選ばれた少なくとも1種の化合物(A)と、アミノベンゼンスルホン酸(B)との共重合体のスルホン化物であって、水溶性およびアルコール可溶性であることを特徴とするアニリン系共重合体スルホン化物。

【請求項2】 アニリン、Nーアルキルアニリンおよびフェニレンジアミン類よりなる群から選ばれた少なくとも1種の化合物(A)と、アミノベンゼンスルホン酸類(B)とを共重合させ、更にスルホン化剤によりスルホン化することを特徴とする請求項1記載のアニリン系共重合体スルホン化物の製法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、アニリン系共重合体スルホン化物とその製法に関し、水あるいはアルコール系溶媒に可溶な導電性ポリマーを提供するものであり、該溶液は、塗布、スプレー、ディップ等の簡便な手法で各種帯電防止用途へ適応可能である。

【従来技術】ドープされたポリアニリンは、導電性ポリ

[0002]

マーとして良く知られているが、ほとんど全ての溶媒に 不溶であり、成形、加工に難点があった。そこで、近年 ドープ剤を添加することなく導電性を発現する水可溶性 のスルホン化ポリアニリンとその合成法が提案されてい る。例えば、スルホン化ポリアニリンの合成法として は、アニリンとmーアミノベンゼンスルホン酸を電気化 学的に重合してスルホン化ポリアニリンを合成する方法 (日本化学会誌, 1985, 1124、特開平02-16616 5号公報)、アニリンとo-、m-アミノベンゼンスル ホン酸を化学的に重合してスルホン化ポリアニリンを合 成する方法(特開平01-301714号公報)、化学 的にあるいは電気化学的に重合して得られたエメラルデ ィンタイプの重合体(ポリアニリン)を無水硫酸/リン 酸トリエチル錯体を用いてスルホン化する方法(特開昭 61-197633号公報)、発煙硫酸でスルホン化す る方法 (J. Am. Chem. Soc., 1991, 113, 2665~2671 頁、J. Am. Chem. Soc., 1990, 112, 2800頁、WO 9 1 -06887) などが知られている。しかしながら、ア ニリンとmーアミノベンゼンスルホン酸を電気化学的に 重合してスルホン化ポリアニリンを合成する方法(日本 化学会誌, 1985, 1124、特開平02-166165号公 報)は、生成物が電極上に形成されるため、単離操作が 煩雑になること及び大量合成が困難であるという問題が ある。特開平01-301714号公報で記載されてい るアニリンとmーアミノベンゼンスルホン酸を過硫酸ア ンモニウムで化学的に重合する方法を本発明者が追試し たところ、繰り返し単位5個に約1個のスルホン基が導 入されるのみであった。また、特開昭61-19763

3号公報の方法でポリアニリンをスルホン化した場合も 同公報7頁に記載されている如く、スルホン化溶媒に対 するポリアニリンの溶解性が充分でなく分散状態で反応 させているため、繰り返し単位5個に約1個のスルホン 基しか導入されない。かくして得られるスルホン基導入 割合の小さいスルホン化ポリアニリンは、導電性及び溶 解性が充分でないという問題がある。また、J. Am. Che m. Soc., 1991, 113, 2665~2671頁、J. Am. Chem. So c., 1990, 112, 2800頁によると、ポリアニリンを発煙 硫酸でスルホン化した場合、繰り返し単位2個に約1個 のスルホン基が導入されると記載されている。しかし、 この方法でポリアニリンを充分にスルホン化しようとし た場合、発煙硫酸に対するポリアニリンの溶解性が充分 でないため、多量の発煙硫酸にポリアニリンを添加する という手段を採らざるを得ず、また発煙硫酸の量が充分 でない場合は、ポリアニリンの一部が固化し、その部分 がスルホン化されないという問題点がある。従って、ポ リマーにドープ剤を添加することなく導電性を発現さ せ、溶解性を向上させるためには、より多くのスルホン 基を芳香環に導入する方法を見い出す必要がある。ま た、塗布による成膜等の成形性を考えた場合、特に親水 性、疎水性いずれの基材にも塗布可能とするためには、 水およびアルコール等に対する溶解性のあることが望ま れる。ところが、これら従来のポリアニリン等のスルホ ン化物は、水に対する溶解性はあるが、アルコール系溶 剤に対する溶解性が充分ではない。

[0003]

【発明が解決しようとしている課題】本発明は、高い導電性を発現させると共に水又はアルコール系溶媒に対する溶解性を向上し、塗布性を向上させたアニリン系共重合体スルホン化物とその製法を提供することを目的とする。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、高い導電 性を有するポリアニリンとして芳香環に対するスルホン 基の導入割合の大きいスルホン化ポリアニリンとその製 法を鋭意検討した結果、モノマーとしてアミノベンゼン スルホン酸類を用いて共重合させ、予めスルホン基を導 入してスルホン化溶媒に対する溶解性を向上させた後、 更にスルホン化することが効果的であることを見い出 し、本発明を完成するに至ったものである。本発明の第 ーは、アニリン、N-アルキルアニリンおよびフェニレ ンジアミン類よりなる群から選ばれた少なくとも1種の 化合物(A)と、アミノベンゼンスルホン酸(B)との共重 合体のスルホン化物であって、水溶性およびアルコール 可溶性であることを特徴とするアニリン系共重合体スル ホン化物に関する。本発明の第二は、アニリン、Nーア ・ルキルアニリンおよびフェニレンジアミン類よりなる群 から選ばれた少なくとも 1 種の化合物(A)と、アミノベ ンゼンスルホン酸類(B)とを共重合させ、更にスルホン

化剤によりスルホン化することを特徴とする請求項1記載のアニリン系共重合体スルホン化物の製法に関する。なお、前記水溶性とは、アニリン系共重合体スルホン化物を0.1Nアンモニア水溶液に1重量%溶解させたとき不溶解物が発生しないことを意味し、アルコール可溶性とは、アニリン系共重合体スルホン化物を0.1Nアンモニアメタノール溶液に1重量%溶解させたとき不溶解物が発生しないことを意味する。

【0005】以下詳細に本発明を説明する。Nーアルキ ルアニリンとしては、N-メチルアニリン、N-エチル アニリン、N-nプロピルアニリン、N-isoプロピル アニリン、Nーブチルアニリン等を挙げることができ、 フェニレンジアミン類としては、フェニレンジアミン、 N-フェニルフェニレンジアミン、N, N' -ジフェニ ルフェニレンジアミン、N-アミノフェニル-N'-フ ェニルフェニレンジアミン等を挙げることができる。ア ニリン、N-アルキルアニリンおよびフェニレンジアミ ン類よりなるAグループのモノマーは、それぞれ単独で 用いられるか、混合して用いられる。Nーアルキルアニ リンを用いると、アルコール系溶剤に対する溶解性及び 疎水性基材に対する塗布性が向上する。また、フェニレ ンジアミン類を用いるとスルホン基の導入割合が増加 し、水に対する溶解性が向上する。N-アルキルアニリ ンのアニリンおよび/またはフェニレンジアミン類に対 して用いられる割合は、アニリンとフェニレンジアミン 類の合計量100に対してNーアルキルアニリン0~3 0が好都合である。N-アルキルアニリンの割合が多す ぎる場合は、水に対する溶解性が低下し、また導電性が 劣る傾向が認められる。アニリンとフエニレンジアミン 類は、それぞれ単独で用いられるか、任意の割合で混合 して用いられる。一般的にアニリンのみを用いてアミノ ベンゼンスルホン酸類と共重合させた場合、スルホン基 の導入割合が低い傾向がある。しかし、フェニレンジア ミン、N-フェニルフェニレンジアミン等のフェニレン ジアミン類を用いると、その添加量に比例しスルホン基 の導入割合が高くなるという利点がある。

【0006】アミノベンゼンスルホン酸類は、o一、m一、pーいずれも用いることが可能である。oーアミノベンゼンスルホン酸またはmーアミノベンゼンスルホン酸とアニリンとの共重合体については、既にJ. Am. Chem. Soc., 1991, 113, 2667頁及び特開平1-301714号公報に記載されているが、本発明者らは、pーアミノベンゼンスルホン酸とアニリンも共重合することを見い出した。なお、pーアミノベンゼンスルホン酸とアニリンとの共重合体は、従来知られている直鎖状の重合体(p位での結合の繰り返し)とは異なる重合体が得られる。

【0007】 重合に用いるアニリン、N-アルキルアニリンおよびフェニレンジアミン類よりなるAグループモノマーとアミノベンゼンスルホン酸類よりなるBグルー 50

プモノマーとのモル比は、A グループモノマーの合計量 100 重量部に対してB グループモノマー $10\sim500$ 重量部が用いられる。アミノベンゼンスルホン酸類は、o-、m-、p-それぞれ単独で用いられるか、任意の割合で混合して用いられる。

【0008】共重合体は、酸性溶媒中、酸化剤で酸化重 合することにより得ることができる。溶媒は、水、メタ ノール、エタノール、イソプロパノール、アセトニトリ ル、メチルイソブチルケトン、メチルエチルケトン、ジ メチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド等が好まし く用いられる。また、酸化剤は、過硫酸アンモニウム、 過酸化水素等が好ましく用いられ、モノマー1モルに対 して0.1~10モル、好ましくは0.5~5モル用い られる。酸は、硫酸、塩酸及びpートルエンスルホン酸 等またはそれらの混合物が好ましく用いられ、酸の濃度 は0.1~5モル/リットル、好ましくは0.2~3モ ル/リットルの範囲で用いられる。反応温度は、70℃ 以下で行うのが好ましく、-20℃~50℃の範囲で行 うのがより好ましい。ここで、アニリンおよび/または N-アルキルアニリンとアミノベンゼンスルホン酸類と の共重合体は、一般的にスルホン基の導入割合が芳香環 に対して10~25%と低く、導電性及び溶解性が不十 分である。しかし、フェニレンジアミン類とアミノベン ゼンスルホン酸類との共重合体は、スルホン基の導入割 合が芳香環に対して25~40%と高くなる傾向があ り、導電性及び溶解性とも良好なスルホン化ポリアニリ ンが得られる。

【0009】得られた共重合体は、無溶媒中又は溶媒中 でスルホン化剤によりスルホン化される。フェニレンジ アミン類とアミノベンゼンスルホン酸類との共重合体は もちろんのこと、アニリンおよび/またはN-アルキル アニリンとアミノベンゼンスルホン酸との共重合体は、 既に芳香環の一部にスルホン基を有しているため、ポリ アニリンと比較してスルホン化剤及び溶媒に対する溶解 性が高く、操作性が向上し、反応がスムースに進行する ためかスルホン基の導入割合が高くなるという利点があ る。スルホン化剤は、濃硫酸、発煙硫酸、三酸化硫黄及 び三酸化硫黄錯体等が好ましく用いられる。濃硫酸及び 発煙硫酸を用いてスルホン化する場合は無溶媒中で、三 酸化硫黄及び三酸化硫黄錯体を用いる場合は溶媒中で反 応するのが好ましい。溶媒は、ジメチルホルムアミド、 ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、N-メ チルピロリドン、ピリジン等が好ましく用いられる。濃 硫酸及び発煙硫酸は、共重合体1gに対して10~20 0g、好ましくは20~100gの範囲で用いられる。 また、三酸化硫黄及び三酸化硫黄錯体は、共重合体1g に対して1~100g、好ましくは5~50g用いられ る。溶媒は、共重合体1gに対して10~300g、好 ましくは20~200g用いられる。反応温度は、20 0℃以下が好ましく、0~100℃が更に好ましい。得

5

られたスルホン化物は、スルホン基の導入割合が芳香環 に対して40~80%へと増加する。

【0010】かくして得られたスルホン化ポリアニリンは、300~500,000の分子量を有し、アンモニア及びアルキルアミン等の塩基又は酢酸アンモニウム、シュウ酸アンモニウム等の前記塩基のカチオンを含む水又はメチルアルコール、エチルアルコール、イソプロピルアルコール等の溶媒又はそれらの混合物に溶解することができる。

[0011]

【実施例】

〈共重合体の合成〉

実施例1~6 (表1、表2参照)

アニリン、N-アルキルアニリン及びフェニレンジアミン類から選ばれた少なくとも1種の化合物とアミノベンゼンスルホン酸類を塩酸溶液に溶解し、過硫酸アンモニウムの塩酸溶液を滴下した。滴下終了後、更に所定時間撹拌したのち、反応生成物を濾別洗浄、乾燥し、共重合体の粉末を得た。

6

10 【表1】

表 1

	モノマー			酸化剤		
実施例	成分1	成分 2	AS	溶媒	酸化剤	溶媒
1	アニリン 15mmol		n-AS 15mmol	1N-HC1 45mi	(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈ 30mmo l	1N-HC1 30ml
2	アニリン 15mmol		p-AS 30mmo1	1N-HC1 68mm1	(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈ 45mmol	1N-HC1 45m1
3	アニリン 13.5mmol	N-Meアニリン 1.5mmol	n-AS 15mmol	1N-HC1 45ml	(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈ 30mmo l	1N-HC1 30m1
4	アニリン 13.5mmol	N-Prアニリン 1.5mmol	n-AS 15mmol	1N-HC1 45ml	(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈ 30mmo l	1N-HCl 30ml
5	N-Ph PDA 15mmol		p-AS 30mmol	1N-HCl 68ml	(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈ 45mmo l	1N-HCl 45ml
6	N-Ph ₂ PDA 10mmol		n-AS 25mmol	1N-HCl 48ml	(NH ₄) ₂ S ₂ O ₈ 30mmo 1	1N-HCl 30ml

〈略 号〉

AS:アミノベンゼンスルホン酸類

N-Meアニリン: N-メチルアニリン

N-Prアニリン: N-プロピルアニリン

N-Ph PDA:N-フェニルフェニレンジアミン

N-Phz PDA:N,N'ージフェニルフェニレンジ

アミン

【表2】

表 2

実施例 —	反応条件		dry set	表面抵抗	スルホン基
	温度	時間	収 量	[0/0]	の導入割合
1	20℃	6 h r	2.1 g	1.4E10	21%
2	40℃	6 h r	1.8g	4.8E10	19%
3	25℃	6 h r	2.3g	1.5E10	20%
4	30℃	12hr	2.0g	2.0E10	21%
5	10℃	12hr	5.7g	2.6E9	35%
6	40℃	12hr	2.8g	1.0E10	30%

【0012】〈スルホン化〉

実施例7、8、9、12(表3、表4参照)

発煙硫酸90gに実施例1~6で得られた共重合体2.0gを加えた後、所定の温度で6時間撹拌した。皮応混合物をエタノール中に滴下し、得られた沈澱物を濾別洗浄、乾燥し、スルホン化ポリアニリンを得た。図1および図2の1000~1100cm-1付近の2本のピークはスルホン基由来の吸収であり、図2の強度は図1の強度より大きくなっており、スルホン基が一層導入されたことを示している。

実施例10

ジメチルホルムアミド200gに三酸化硫黄30gを加 30え1時間撹拌した後、実施例4で得られた共重合体2. 0gを添加、20℃で6時間撹拌した。反応混合物をエタノール中に滴下し、得られた沈澱物を濾別洗浄、乾燥し、スルホン化ポリアニリンを得た。

実施例11

濃硫酸200gに実施例5で得られた共重合体2.0g を加えた後、70℃で6時間撹拌した。反応混合物をエ タノール中に滴下し、得られた沈澱物を濾別洗浄、乾燥 20 し、スルホン化ポリアニリンを得た。

比較例 1

J. Am. Chem. Soc., 1991, 113, 2666頁に記載された方法に準じ、スルホン化ポリアニリンを合成した。ポリアニリン2.0gを発煙硫酸200gに添加し、室温で撹拌溶解した。しかし、ポリアニリンを加えた際、ポリマーの一部が固化したため、溶液が均一になるまでに24時間以上の時間を要した。次に、この溶液にメタノールを加え、さらにアセトンを加えた後、得られた沈殿物をろ別、洗浄、乾燥し、スルホン化ポリアニリン1.9gを得た。スルホン化率は42%であった。得られた生成物1gを0.1Nアンモニア水溶液100gに溶解し、ろ過したところ、不溶物が認められた。ガラス基板上に薄膜を形成し、表面抵抗を測定したところ、7.6×10¹⁰ Ω/□であった。また、0.1Nアンモニアメタノール溶液に溶解した場合も、上記と同様不溶物が認められた。

【表3】

表 3

10

実施例	スルホン化			反応条件	
	ポリマー	スルホン化剤	溶媒	温度	時間
7	実施例1 2.0g	発煙硫酸 90g		5℃	6 h r.
8	実施例2 2.0g	発煙硫酸 90g		5℃	6 h r
9	実施例3 2.0g	発煙硫酸 90g		20℃	6 h r
1 0	実施例4 2.0g	三酸化硫黄 30g	DMF 200g	20℃	6 h r
11.	実施例 5 2.0g	濃硫酸 200g		70℃	6 h r
1 2	実施例6 2.0g	発煙硫酸 90g		10℃	6 h r

〈略 号〉

DMF:ジメチルホルムアミド

【表4】

表 4

		表面抵抗	スルホン基	不溶解物	
実施例	収 量	[0/0]	の導入割合	水浴煤系	アルコール 溶 媒 系
7	2.4 g	1.8E9	48%	なし	なし
8	2.2g	5.0E9	43%	なし	なし
9	2.5 g	1.5E9	47%	なし	なし
1 0	1.7g	2.0E9	45%	なし	なし
11	1.9g	8.7E8	5 4 %	なし	なし
1 2	2.3 g	4.2E8	56%	なし	なし

(注)

成膜後の表面抵抗

得られた生成物 1 g を 0. 1 N アンモニウム水溶液 1 0 0 g に溶解し、ろ過した。ガラス基板上に薄膜 (2 0 0 ~500Å)を形成したのち、膜の表面抵抗を測定し

た。

. スルホン化率の測定法

スルホン化率は、燃焼フラスコにより試料を分解後、イ オンクロマト法により硫黄含有率を測定し求めた。

50 溶解性の評価法

11

スルホン化ポリアニリンを下記の①または②に1重量% 溶解させ、その溶液について不溶解物の有無を観察した。

①水溶媒系: 0. 1 Nアンモニア水溶液に溶解②アルコール溶媒系: 0. 1 Nアンモニアメタノール溶液に溶解

[0013]

【作用効果】本発明によると、ポリマー中のスルホン基 の導入割合が増大し、ドープ剤を添加することなく導電 性の向上が図れ、水及びアルコール系溶媒に対する溶解 性が向上する。従って、本発明のポリマーを含む溶液を 用いて塗布、スプレー、ディップ等の処理で基材に薄膜 を形成する場合、ピンホールのない均一な高導電性の薄 膜が形成可能である。

12

【図面の簡単な説明】

【図1】実施例2で合成した共重合体のKBr錠剤法によるFT-1Rスペクトルである。

【図2】実施例8で合成したスルホン化ポリアニリンの KBr錠剤法によるFT-1Rスペクトルである。





